(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-186066 (P2000-186066A)

(43)公開日 平成12年7月4日(2000.7.4)

(51) Int.Cl."	機別記号		FΙ				テーマコード(参考)
C 0 7 C 211/54			C 0	7 C 211/54			2H068
209/06				209/06			3 K 0 0 7
C 0 7 D 209/86			C 0	7 D 209/86			4 C 0 3 6
213/38				213/38			4 C 0 5 5
279/22				279/22			4 C 0 6 3
		審查請求	未結束	請求項の数7	OL	(全 28 百)	最終頁に続く

(21)出顯番号	特願平10-364801	(71)出願人	000006079	
			ミノルタ株式会社	
(22) 出順日	平成10年12月22日(1998, 12, 22)	大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13		
			大阪国際ビル	
		(72)発明者	藤野 秦光	
		大阪府大阪市中央区安土町二丁目		
			大阪国際ピル ミノルタ株式会社内	
		(72) 発明者	植田 秀昭	
			大阪府大阪市中央区安十町二丁目3番13号	
			大阪国際ピル ミノルタ株式会社内	
		(74)代理人	100062144	
		(14)1647	弁理士 青山 葆 (外2名)	
			升理工 育山 條 (外2石)	
			mah water d	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 新規アミノ化合物とその製造方法、及び用途

(57)【要約】

【課題】 電子写真感光体や有機エレクトロルミネッセ ンス素子に利用可能な新規アミノ化合物を提供するこ

と。 「解決手段」 下記一般式 (1) で表わされるアミノ化 合物とその製法、及び用途: (式中、Ar¹は置換もし くは無面換のアリーレン基、あるいは準結合を表わす: Ar¹は置換しくに無面換のアリーレン基を表わす R¹、R²はそれぞれ独立して、アルキル基、アラルキル 基、置換もしくは無面換のアリール基。置映もしくは無 塑換の予系技術環想を表わし、R¹とR²は一体となっ て環を形成してもよい; Xは下記一般式 (11) で表わ される連結室で、Ar²は置換もしくは無面換のアリー ル基を表わず。

$$R^{1} \xrightarrow{R^{2}} Ar^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{2}$$

$$R^{2} \xrightarrow{R^{2}} R^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{2}$$

$$R^{2} \xrightarrow{R^{1}} R^{2}$$

$$R^{2} \xrightarrow{R^{2}} R^{3}$$

$$R^{3} \xrightarrow{R^{2}} R^{3}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で表わされるアミノ化 会物·

【化1】

(式中、Ariは置換もしくは無置換のアリーレン基、あ るいは単結合を表わす:Ar2は置換もしくは無置換の アリーレン基を表わす; R1、R2はそれぞれ独立して、 アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアリ 一ル基、置換もしくは無置換の芳香槟物素環基を表わ 下記一般式(II)で表わされる連結基で、Ar3は置 換もしくは無置換のアリール基を表わす):

【化2】

【請求項2】 下記一般式(III)で表されるハロゲ ン化合物:

【化3】

(式中、Ar¹、Ar²、Xは請求項1に記載のものと同 意義: Yはハロゲン原子を表わす)と下記一般式(I V)で表わされるアミノ化合物:

【化41

$$H = \sqrt{\frac{R^1}{R^2}}$$
 (IV)

(式中、R1、R2は前記と同意義)を反応させることを特 微とする、下記一般式(I)で表わされるアミノ化合物 の製造方法:

【化5】 (1)

(式中、Ar1、Ar2、R1、R2、Xは前記と同意義)。 【請求項3】 (a) 下記一般式(V) で表わされるジ ホルミル化アリール化合物:

[4:6]

10

し、R1とR2は一体となって環を形成してもよい; Xは 20 (式中、Ar4は置換もしくは無置換のアリーレン基を表 わす)と下記一般式 (VI) で表わされるアセチル化ア リール化合物:

【化7】

(式中、Ar5は置換もしくは無置換のアリーレン基を表 わす:Yはハロゲン原子を表わす)を反応させてビリリ ウム塩を得る工程:

30 (b) 前記ピリリウム塩をアンモニア溶液中で加熱処理 下記一般式(VII)で表わされるハロゲン化ピリ ジン誘導体:

【化8】

$$Ar^{5}$$

$$Ar^{4}$$

$$Ar^{5}$$

$$Ar^{5}$$

$$Ar^{5}$$

$$Ar^{5}$$

$$Ar^{5}$$

(式中、Ar⁴、Ar⁵、Yは前記と同意義)に転化させる 工程:および

(c)得られた前記ハロゲン化ビリジン誘導体と下記ー 椴式(IV)で表わされるアミノ化合物: 【化9】

50

1/21/2010, EAST Version: 2.4.1.1

$$H = N \frac{R^{1}}{R^{2}} \qquad (IV)$$

(式中、R¹、R²は請求項1に記載のものと同意義)を反 応させる工程から成る、下記一般式で表わされるアミノ 化合物の製造方法。

【化10】

(式中、Ar⁴、Ar⁶、R¹、R²は前記と同意義)。【請求項4】 (a)下記一般式(V)で表わされるジホルミル化アリール化合物:

【化11】

(式中、Ar*は置換もしくは無置換のアリーレン基を表 わす)と下記一般式 (VI)で表わされるアセチル化ア リール化合物:

リール化合物 【化12】

$$Y - A_{r}^{5} - C - CH_{3}$$
 (VI)

(式中、Ar⁵は置換もしくは無置換のアリーレン基を表 わす; Yはハロゲン原子を表わす)を反応させてビリリ ウム塩を得る工程;

- (b)次いで前記ピリリウム塩と下記一般式 (VII I)で表わされるカルボン酸塩:
- I)で表わされるカルボン酸塩【化13】

(式中、Ar®は置換もしくは無置換のアリール基を表 わす)を反応させ、下記—般式(IX)で表わされるハ ロゲン化アリール化合物;

【化14】

$$A r^{6} \xrightarrow{Ar^{5}} Ar^{4} \xrightarrow{Ar^{5}} A r^{6} \qquad (X)$$

 (式中、Ar⁴、Ar⁵、Ar⁵、Yは前記と同意義)を 得る工程:および

(c) このようにして得られた前記ハロゲン化アリール 化合物と下記一般式 (IV) で表わされるアミノ化合 物:

【化15】

$$H = N \frac{R^1}{R^2}$$
 (IV)

(式中、R¹、R²は請求項1に記載のものと同意義)を 反応させる工程から成る、下記一般式で表わされるアミ ノ化合物の製造方法;

【化16】

(式中、Ar⁵、Ar⁶、R¹、R²は前記と同意義) 【請求項5】 請求項1記載のアミノ化合物からなる正 孔輸送材料。

【請求項6】 一対の電価間に発光層または発光層を含 む複数の有機化合物薄数を備えた有機エレクトロルミネ ・レンス素子において、少なくとも一層が、請求項1記 核のアミノ化合物を含有する層であることを特徴とする も 有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 導電性支持体上に、電荷発生材料及び、 電荷輸送材料を使用してなる電子写真感光体において、 電荷輸送材料が請求項5記載の正孔輸送材料であること を特徴とする電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、新規なアミノ化合物とその製造方法、及びその用途に関する。本発明のアミノ化合物は発光材料、最低光薄電材料等に使用するこちのとかでき、より具体的には、面光源や表示に使用される 有橋エレクトロルミネッセンス素子や電子写真感光体に 有用である。

[0002]

【従来の技術】感光体や電荷輸送材料として開発されて いる有機光導電性材料は、低コスト、加工性が多様であ り、無公害性などの多くの利点があり、多くの化合物が 提案されている。例えば、オキサジアゾール化合物、ヒ ドラゾン化合物、ビラゾリン化合物、オキサゾール化合 物、アリールアミン化合物、ベンジジン化合物、スチル ベン化合物、ブタジエン化合物などの有機光導電材料が 10 cd/m²、最大発光効率は1.51m/Wを達成して、実用 提案されている。

【0003】電荷輸送材料を利用した技術の一つとし て、電子写真感光体が挙げられる。電子写真方式は、カ ールソンにより発明された画像形成法の一つである。こ の方式は、コロナ放電により感光体を帯電した後、像露 光して感光体上に静雪潜像を形成させ、該静雪潜像上に トナーを付着させて現像し、得られたトナー像を紙に転 写することからなる。

【0004】このような電子写直方式における感光体に 要求される基本的な特性としては、暗所において適当な 20 電位が保持されること、暗所における電荷の散逸が少な いこと、光照射により速やかに電荷を散逸することなど が挙げられる。従来の電子写真感光体は、セレン、セレ ン合金、酸化亜鉛、硫化カドミウムなどの無機光導電体 が使用されてきた。これらの無機光導電体は、耐久性が 高く 耐削枚数が多いたどの利占を有しているが 製造 コストが高い、加工性に劣る、毒性を有するなどの問題 占が指摘されている。

【0005】これらの欠点を克服するため、有機光導電 体の開発が行われているが、従来までの有機光導電体を 30 電荷輸送材料に用いた電子写真感光体は 帯電性 感 度、及び残留電位などの電子写真特性が必ずしも満足さ れているものとは言えないのが現状であり、優れた電荷 輸送能力を有し、耐久性のある電荷輸送材料の開発が望 まれていた。

【0006】電荷輸送材料を利用した技術として、有機 エレクトロルミネッセンス素子が挙げられる。有機化合 物を使用したエレクトロルミネッセンス素子は、固体発 光型の安価な大画面フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、数多くの研究が行われている。

【0007】一般に有機エレクトロルミネッセンス素子 は、発光層及び、該発光層を挟んだ一対の対向電極から 構成されている。発光は、両電極間に電界が印加される と、陰極から電子が注入され、陽極から正孔が注入され る。さらに、この電子と正孔が発光層において再結合 エネルギー進位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエ ネルギーを光として放出する現象である。

【0008】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子 は、無機エレクトロルミネッセンス素子に比べて駆動電 圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性 50 を置換基として有していてもよい。

劣化も著しく実用化には至らなかった。近年、10V以 下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率を持った有機化 合物を含有した薄膜を積層した有機エレクトロルミネッ センス素子が報告され、関心を集めている(アプライド フィジックス・レターズ、51巻、913ページ、1 987年参照)。

【0009】この方法は、金属キレート錯体を発光層、 アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色 発光を得ており、6~7Vの直流電圧で輝度は数100 領域に近い性能を持っている。しかしながら、現在まで の有機エレクトロルミネッセンス素子は、構成の改善に より発光効率は改良されてきてはいるが、未だ充分な発 光輝度は有していない。また、繰り返し使用時での安定 性に劣るという大きな問題点を持っている。

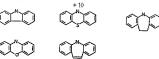
【0010】従って、より大きな発光輝度を持ち、繰り 返し使用時での安定性に優れた有機エレクトロルミネッ センス素子の開発のために、優れた電荷輸送能を有し、 耐久性のある電荷輸送材料の開発が望まれている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上の様な事 情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、 耐久性のある電荷輸送材料や発光材料として有用な、新 **坦アミノ化合物とその製造法、及びその用途を提供する** ことにある。 [0012]

【課題を解決するための手段】すなわち 本登明は 下 記一般式(I)で表わされる新規なアミノ化合物を提供 するものである。

一般式(I)中、Ariはフェニレン基、ビフェニレン 基、ターフェニレン基、ナフチレン基等のアリーレン 基、あるいは単結合を表わし、好ましくはフェニレン 基、ピフェニレン基などである。それらの基は、メチル 基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基などの アルキル基 メトキシ基 エトキシ基 プロボキシ基な どのアルコキシ基、ベンジル基などのアラルキル基、フ ェニル基、ビフェニル基、ナフチル基などのアリール 基、チエニル基、フリル基、ピリジル基などの複素環基 【0013】一般式(1)中、Ariはフェニレン基、ビフェニン基、ターフェニン基、ナフチレン基等の デリーンン基を表わし、好ましくはフェニレン基、ビフェニンとなる。それらの基は、メチル基、エチル基、エーンロビル基、イツプロビル基などのアルキル 基、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基などのアルキンコキシ基、ベンジル基などのアラルキル基、フェニル 基、ビフェニル基、ナフチル基などのアリール基、チエニル基、フリル基、ビリジル基などの復業環基を置換ま として有していてもよい。



を形成してもよい。好ましくは、フェニル、 R^1 、 R^2 が一体となって形成した環;



である。これらの環は、メチル基、エチル基、n-プロ ビル基、イソプロビル基等のアルキル基、メトキシ基、 エトキシ基、プロボキシ基等のアルコキシ基を置換基と して有していてもよい。

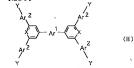
【0015】一般式(I)中、Xは下記一般式(II) で表わされる連結基; 【化20】

$$-N = -C = -C = (1)$$

を表わし、Ar*はフェル基、ビフェル基、ナフチル基等のアリール基を表わし、教ましくはフェニル基、ビフェニル基等である。それらの編はメチル基、エチル基、ロープロビル基、イソプロビル基等のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ブロボキシ基等のアルコキシ基、ベンジル基等のアラルキル基、ジアルキルアミノ基、あるいはジアリールアミノ基等を置換基として有していてもしい。

【0016】一般式(I)で表わされるアミノ化合物 は、特定の原料物質を用い公知の化学反応を利用して製※ *【0014】一般式(1)中、R1、R1はそれぞれ独立して、メチル基、エチル基、エーアロビル基、イソプロビル基等のアルギル基、、ンジル基等のアラルキル基、選換もしくは無置換のフェニル基、ビフェニル基、ナナル基等のアリール基、置換しくは無質物のチエニル基、フリル基、ビリジル基等の芳香族機業環基を表わし、R1とR1は一株となって、R1およびR1が結合する登素原アと共に環、例えば;【化18】

※遵することが可能である。例えば、下記一般式(III)で表わされるハロゲン化合物;
 【化21】
 Y



(式中、Ar¹、Ar²、Xは一般式(I)中と同意義: Yはハロゲン原子を表わす。)と下記一般式(IV)で30 表わされるアミノ化合物;

$$H = N \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \end{pmatrix} \qquad (N)$$

(式中、 ${
m R}^1$ 、 ${
m R}^2$ は一般式(${
m I}$)中と同意義)を反応させることによって製造することができる。

基、ペンジル基等のアラルキル基、ジアルキルアミノ 基、あるいはジアリールアミノ基等を置換基として有し 40 ハロゲン化アリール化合物の製造例として、下記スキー ム:

【化231

で示される。 【0018】下記一般式(V)で表わされるジホルミル 化アリール化合物:

化アリール化合物; 【化24】

$$H = C - A r^{4} - C - H$$

$$Q = Q$$

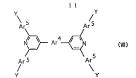
$$(V)$$

(式中、A いはフェニンと基、ビフェニンと基、ターフェニンと基、ナフチレン基等のアリーレン基を表わし、新生しくはフェニンと基、ビフェニンと基などである; それらの基は、メチル基、エチル基、ローブロビル基、ストキン基、アロボキシ基などのアルコキシ基、メトキン基、アロボキシ基などのアルコキシ基、ベンジル基などのアラルキル基、フェニル基、サンチーアカ・北直とのアラルキル基、フェニル基、フリル基、大コニールは、フェニルを表がとのアラルキル基、フェニルを表していてもよい)と下温一般式(V1)で表わされるアセチル化アリキの (代26)

 $\begin{array}{c} (425) \\ Y - Ar^5 - C - CH_3 \\ 0 \\ \end{array}$ (VI)

* ール化合物;

【0019】(式中、Ar%はフェニン・基、ビフェニレン基、ターフェニンン基、ナフキレン基等のアリーレン基を表わし、超ましくはフェニレン基、ビフェニン基などであるこそれらの居は、メチル基、エチル基、ロープロビル基、イソアロビル基をグのアルキル基、メニル基、ボンジル基などのアラルキル基、フェニル基、ブリル基、ビリジル基などの容別本の基の基準に関係していてもよい)を反応させてリリカム塩を得た後、アンモニア溶液中、加速処理することによって、下部一板、ズ(V11)で表わる人のアゲン化とリジン消毒率は、スポースを表していてもよい)を反応させてリリカム塩を得た後、アンモニア溶液中、加速処理することによって、下部一板、ズ(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ズ(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ス(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ス(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ス(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ス(V11)で表わされるハロゲン化とリジン消毒率、ストロースを表しました。



【0020】(式中、Ar⁴、Ar⁵、Yは前記と同意 義) に転化さたり、また、前記と同様に下記一般式 (V) で表わされるジホルミル化アリール化合物:

(式中、Ar⁴は前記と同意義)と下記一般式(VI) で表わされるアセチル化アリール化合物:

[4:28]

$$Y - Ar^{5} - C - CH_{3}$$
 (VI)

(式中、Ar5、Yは前記と同意義)を反応させビリリ ウム塩を得た後、下記一般式(VIII)で表わされる カルボン酸塩:

$$(1129)$$
Ar⁶— C — O⁻ Na⁺ (VIII)

【0021】(式中、Ar8はフェニル基 ビフェニル 基、ターフェニル基、ナフチル基等のアリール基を表わ し、好ましくはフェニル基、ビフェニル基などである; それらの基は、メチル基、エチル基、nープロビル基、 イソプロビル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキ シ基 プロボキシ基などのアルコキシ基 ベンジル基な どのアラルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチ ル基などのアリール基、チエニル基、フリル基、ピリジ ル基などの複素環基を置換基として有していてもよい) ゲン化アリール化合物:

【化30】

$$\begin{array}{c}
A_{1} \\
A_{7} \\
A_{7}$$

10 (式中、Ar⁶、Ar⁵、Ar⁶、Yは前記と同意義)を 得ることができる。

【0022】これらのハロゲン化合物と下記一般式(I V)で表わされるアミノ化合物;

【化31】 (IV)

20 (式中、R1、R2は上記と同意義)を反応させることに よって下記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を製 造することができる。

【化32】 (1)

(式中、Ar1、Ar2、R1、R2、Xは前記と同意 義)。上記アミノ化合物の合成は、塩基性化合物または 遷移金属化合物触媒と、溶媒との存在下、[]] Imann反応 により行うことができる。

【0023】上記アミノ化合物の合成に用いられる塩基 性化合物としては、アルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、 を反応させれば、下記一般式(IX)で表わされるハロ 40 炭酸水素塩、アルコラートなどが一般的であるが、第4 級アンモニウム化合物や脂肪能アミンや芳香能アミンの 様な有機塩基を用いることも可能である。この中で、ア ルカリ金属や第4級アンモニウムの炭酸塩や炭酸水素塩 が好ましいものとして用いられる。更に、反応速度、及 び熱安定性という観点から、アルカリ金属の炭酸塩や炭 酸水素塩やアルコラートが最も好ましい。

> 【0024】合成に用いられる遷移金属、又は遷移金属 化合物触媒としては、例えば、Cu、Fe、Ni、C r、V、Pd、Pt、Ag等の金属、及びそれらの化合 50 物が用いられるが、収率の点から、網、パラジウム、又

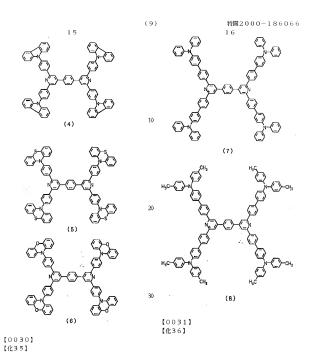
30

【0025】合成で用いられる溶線は、一般的に用いられる溶線であればよいが、ジクロロベンゼン、ニトロベンゼン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルビロリドン等の非プロトン性極性溶媒が好ましく用いられる。

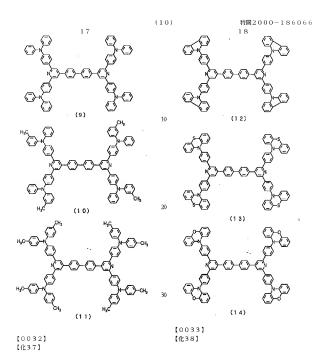
【0025】反応は、一般的には、常圧下100で~2 20 50での温度範囲内で行われるが、加圧下で行っても差 し支えない。反応終了後、反応流中の固形分を除去した 後、溶媒を滅圧が去して目的物を得ることができる。 【0027】上記アミノ化合物の具体例として、以下の ものが挙げられる。尚、これらの例は、未発明のアミ ノ化合物を削削的に提示しているものでも、またこれら に限定する意図で開示しているものでもない。 【0028】 【033】

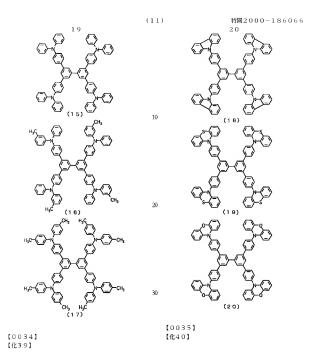
(1)

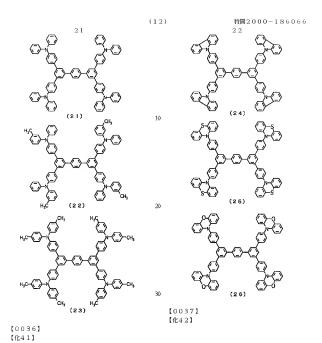
【0029】 【化34】

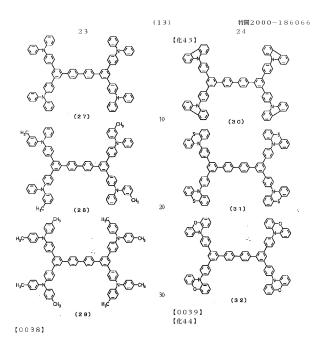


1/21/2010, EAST Version: 2.4.1.1



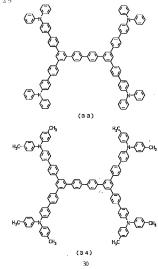


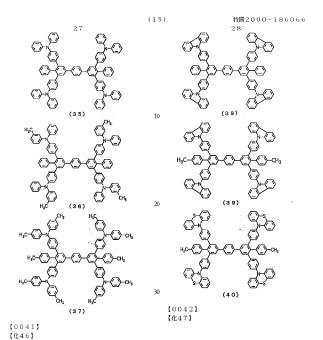


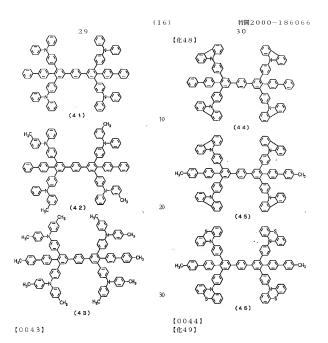


特開2000-186066

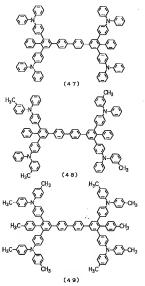
【0040】 【化45】



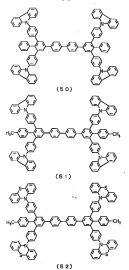




3 1



【0045】 【化50】



【0046】一般式(I)で表わされるアミノ化合物 は、電荷輸送機能、特に正孔輸送機能に優れており、か 一つ、耐久性、耐熱性に優れている。そのため、本発明の 一般式(I)で表わされるアミノ化合物は電荷輸送材料 としての用途に優れており そのような機能を利用して 種々の応用が考えられ、例えば感光体または有機エレク トロルミネッセンス素子の電荷輸送材料として、好適に 使用することができる。

【0047】まず、一般式(I)で示されるアミノ化合 40 コニウム、フッ化マグネシウム等の金属化合物や有機顔 物を電子写直感光体として用いる場合について説明す る。一般式(I)で示されるアミノ化合物は、電子写真 感光体のいずれの層においても使用できるが、高い電荷 輸送特性を有することから電荷輸送材料して使用するこ とが望ましい。

【0048】上記アミノ化合物は電荷輸送物質として作 用し、光吸収により発生した、もしくは電極より注入し た電荷を極めて効率よく輸送できるので、感度、高速応 答性に優れた感光体を得ることが可能である。また、該 化合物は、耐オゾン性、光安定性に優れているので、耐 50 溶液中に分散させて作成した塗布液を塗布乾燥して形成

久性に優れた感光体を得ることができる。

【0049】電子写真感光体としては、例えば、導電性 支持体上に電荷発生材料と電荷輸送材料とを適当なバイ ンダ樹脂に分散してなる感光層を形成してなる単層型の 感光体、支持体上に感光層として電荷発生層と電荷輸送 層とを積層してなる感光体、支持体上に下引層や導電層 とを形成し、その上に感光層を形成してなる感光体、あ るいは支持体上に下引層、感光層及び表面保護層を順次 積層してなる感光体が挙げられる。

10 【0050】支持体としては、網、アルミニウム、鉄、 ニッケル、ステンレス等の箔、あるいは板やドラム形状 にしたものが使用される。またこれらの金属を紙やプラ スチックドラム等に真空蒸着、無電解メッキしたもの、 あるいは漢雲性ポリマー、酸化インジウム、酸化スズ等 の導電性化合物の層を紙あるいはプラスチックドラムト に塗布もしくは萎着によって設けたものも使用可能であ る。一般的にはアルミニウムが使用され、例えば押し出 し加工後、引き抜き加工を施したアルミニウムパイプを 切断し、その外表面をダイヤモンドバイト等の切削工具 20 を用いて、約0,2~0,3mmに切削し仕上げたもの (切削管)や、アルミニウム円板を深絞り加工してカッ プ状とした後、外表面をしごき加工によって仕上げたも の(DI管)、アルミニウム円板をインパクト加工して カップ状とした後、外表面をしごき加工によって仕上げ たもの(EI管)、押し出し加工後、冷間引き抜き加工 したもの(ED管)等が挙げられる。また これらの表 面をさらに切削したものを使用してもよい。

【0051】支持体上に下引層を形成する場合、支持体 表面を陽極酸化させて得られる酸化皮膜を下引層として 30 用いることがよく行われる。支持体がアルミ合金の場 合 アルマイト層を下引層として用いることが効果的で ある。また、適当な樹脂を溶解させた溶液や、その中に 低抵抗化合物を分散させ、この溶液や分散液を上記導電 性支持体上に塗布し、乾燥させることによっても形成さ れる。この場合、下引層に用いられる材料としては、ポ リイミド、ポリアミド、ニトロセルロース、ポリビニル ブチラール、ポリビニルアルコール等が適当で、これら の樹脂に低低抗化合物を分散させてもよい。低低抗化合 物としては、酸化錫、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジル 料 電子吸引性有機化合物 有機金属錯体等の有機化合 物が好適に用いられる。下引層の隙厚は、0, $1\sim5\mu$ m. 好ましくは0, 2~3μm程度が望ましい。

【0052】上記支持体上または下引層上に感光層が形 成されるが、以下、感光層として電荷発生層と電荷輸送 層とを積層する場合について説明する。電荷発生層を形 成するにあたっては、電荷発生材料を真空蒸着するか、 あるいは適当な溶媒に溶解せしめて塗布するか、顔料を 適当な溶剤もしくは必要があれば結着樹脂を溶解させた する。接着性の点からみて、樹脂中に分散させたものが 良好である。電荷発生層の膜厚は0,01~2μm、好 ましくは0.05~1 m 程度が望ましい。電荷発生層 を形成するために使用されるバインダー樹脂は、電荷発 生材料に対して100重量%以下が好ましいが、この限 りではない。樹脂は2種類以上組み合わせて使用しても LW.

【0053】電荷発生層に用いる電荷発生材料として は、例えば、アゾ系材料(ビスアゾ系顔料、トリスアゾ 染料、オキサジン系染料、キサンテン系染料、シアニン 系色素、スチリル系色素、ピリリウム系染料、キナクリ ドン系顔料、インジゴ系顔料、ペリレン系顔料、多環キ ノン系顔料、ビスベンズイミダゾール系顔料、インダス ロン系顔料、スクアリウム系顔料、フタロシアニン系顔 料等の有機系顔料、及び染料等が挙げられる。これ以外 でも、光を吸収し極めて高い確率で電荷担体を発生する 材料であれば、いずれの材料であっても使用することが できるが、特にアゾ系 (ビス系、トリス系) 顔料やフタ ロシアニン顔料が好ましい。

【0054】また、この電荷発生材料と共に使用する樹 脂としては、例えば、飽和ポリエステル樹脂、ポリアミ ド樹脂、アクリル樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合 体、イオン架橋オレフィン共重合体(アイオノマー). スチレンーブタジエンブロック共重合体、ポリアリレー ト ボリカーボネート 塩化ビニル-酢酸ビニル共重合 体、セルロースエステル、ポリイミド、スチロール樹 脂、ボリアセタール樹脂、フェノキシ樹脂等の熱可塑性 結着剤、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹 脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、ア 30 トリフェニルメタン化合物、オキサジアゾール化合物、 ルキッド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂等の熱硬化結着 剤、光硬化性樹脂、ボリーN-ビニルカルバゾール、ボ リビニルピレン、ボリビニルアントラセン等の光導電性 樹脂を使用することができる。

【0055】上記の電荷発生材料をこれらの樹脂と共 に、メタノール、エタノール、イソプパノール等のアル コール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキ サノン等のケトン類、N、N-ジメチルアセトアミド等 のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド 類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコ 40 様々な化合物を使用することができる。 ールモノメチルエーテル等のエーテル類。酢酸メチル。 酢酸エチル等のエステル類。 クロロホルム、塩化メチレ ン、ジクロロエタン、四塩化炭素、トリクロロエチレン 等の脂肪族ハロゲン化炭化水素類、あるいはベンゼン、 トルエン、キシレン、リグロイン、モノクロロベンゼ ン、ジクロロベンゼン等の芳香族等の有機溶剤に分散。 あるいは溶解させて囲製した感光塗液を、上記導電性支 持体上に塗布し、乾燥させて電荷発生層を設けるように する。上記のようにして形成された電荷発生層の上に電 荷輸送材料とバインダー樹脂を含有する電荷輸送層を設 50 これらの溶媒は、1種単独で使用してもよく、あるい

118.

【0056】バインダー樹脂としては、例えば、ボリカ ーボネート、ポリアリレート、飽和ポリエステル樹脂、 ボリアミド樹脂、アクリル樹脂、エチレン一酢酸ビニル 共重合体、イオン架橋オレフィン共重合体(アイオノマ 一)、スチレンーブタジエンブロック共和合体、ボリア リレート、ポリカーボネート、塩化ビニルー酢酸ビニル 共重合体、セルロースエステル、ボリイミド、スチロー ル樹脂、ボリアセタール樹脂、フェノキシ樹脂等の熱可 系顔料を含む)トリアリールメタン系染料、チアジン系 10 塑性結着剤、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン 樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、 アルキッド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂等の熱硬化結着 剤、光硬化性樹脂、ボリーN-ビニルカルバゾール、ボ リビニルビレン、ボリビニルアントラセン等の光導電性 樹脂を使用することができる。

> 【0057】感光体の電荷輸送層を形成するにあたって は、電荷輸送材料とバインダー樹脂とを適当な溶剤に溶 解させて得られる塗布溶液を、上記の電荷発生層の上に 塗布し、乾燥させる。電荷輸送層の膜厚は、5~60μ 20 m、好ましくは10~50μm程度が望ましい。

【0058】また、電荷輸送層中の電荷輸送材料の含有 量は、その種類により一概には規定できないが、バイン ダー樹脂1重量部に対して概ね0.02~2重量部、好 ましくは0.5~1.2重量部添加することが望まし い。感光体に使用される電荷輸送材料は、一般式(I) で表わされる化合物を2種以上使用してもよいし、他の 雷荷鈴送材料と組み合わせて使用することもできる。 【0059】使用される他の電荷輸送材料としては、ヒ ドラゾン化合物、ピラゾリン化合物、スチリル化合物、

カルバブール化合物 スチルベン化合物 エナミン化合 物、オキサゾール化合物、トリフェニルアミン化合物、 テトラフェニルベンジジン化合物、アジン化合物等の正 孔輸送材料や、フルオレノン化合物、アントラキノジメ タン化合物、ジフェノキノン化合物、スチルベンキノン 化合物 チオピランジオキシド化合物 オキサジアゾー ル化合物、ペルレンテトラカルボン酸化合物、フルオレ ニリデンメタン化合物、アントラキノン化合物、アント ロン化合物、シアノビニル化合物等の電子輸送材料等、

【0060】電荷輸送層の形成の際に使用する前記溶媒 としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、ク ロロベンゼン等のケトン、メタノール、エタノール、イ ソプロパノール等のアルコール、酢酸エチル、エチルセ ロソルブ等のエステル、四塩化炭素、四臭化炭素、クロ ロホルム、ジクロロメタン、テトラクロロエタン等のハ ロゲン化炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、ジエチルホルムアミド等を挙げることができる。

は、2種以上を混合溶媒として併用してもよい。 【0061】上述したような積層型の感光層を形成する 場合、電荷輸送層、及び電荷発生層の塗布は公知のもの など各種の塗布装置を用いて行うことができる。具体的 には、浸漬コーティング法、スプレーコーティング法、 スピナーコーティング法、ブレードコーティング法、ロ ーラーコーティング法、ワイヤーバーコーティング法等 の色々なコーティング法を用いることができる。

【0062】また、上述したような積層型の感光層の場 合には、特に電荷輸送層中に、成膜性あるいは可撓性を 10 電層を設けてもよい。導電層としては、アルミニウム、 向上させるための添加剤、残留電位の蓄積を抑制するた めの添加剤等、周知の添加剤を含有させてもよい。 【0063】これらの具体的な化合物としては、ハロゲ ン化パラフィン、ボリ塩化ビフェニル、ジメチルナフタ レン、o-ターフェニル、m-ターフェニル、p-ター フェニル、ジエチルビフェニル、水素化ターフェニル、 ジイソプロピルビフェニル、ベンジルビフェニル、ジイ ソプロビルナフタレン、ジベンゾフラン、9,10-ジ ヒドロキシフェナントレン等の可塑剤やクロラニル、テ トラシアノキノジメタン、テトラシアノエチレン、トリ ニトロフルオレノン、ジシアノベンゾキノン、テトラク ロロ無水フタル酸、3,5ジニトロ安息香酸、シアノビ ニル化合物等の電子吸引性増感剤、メチルバイオレッ ト. ローダミンB. シアニン染料、ピリリウム塩、チア ピリリウム塩等の増感剤が使用可能である。

【0064】可塑剤の添加量が多い程 その層の内部応 力が低減されるため 感光層が電荷輸送層と電荷発生層 との積層により構成される場合には、電荷輸送層と電荷 発生層との間の接着性が、また、単層型の場合には感光 層と支持体間の接着性が改善される。しかし、多すぎる 30 ピンコートすることにより形成すればよい。 と 機械的強度の低下や感度の低下等の問題が発生する。 ため、電荷輸送材料100重量部に対して1~100重 量部、好ましくは5~80重量部、より好ましくは10 ~50重量部程度添加することが望ましい。増感剤の添 加量は、電荷輸送材料100重量部に対して0.01~ 2.0重量部 好ましくは0.1~10重量部 より好ま しくは0.5~8重量部程度添加することが望ましい。 【0065】さらに、感光体の感光層、特に電荷輸送層 には、オゾン劣化防止の目的で酸化防止剤を添加しても よい。酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール、ヒ 40 ンダードアミン、パラフェニレンジアミン、ハイドロキ ノン、スピロクロマン、スピロインダノン、ヒドロキノ リンおよびこれらの誘導体や、有機燐化合物、有機硫黄 化合物等が挙げられる。

【0066】酸化防止剤の添加量は、多いほど接着性は 向上するものの、多すぎると機械的強度の低下や感度の 低下等の問題が発生し、少なすぎると酸化防止の充分な 効果が得られない。したがって、電荷輸送材料100重 量部に対して0.1~50重量部、好ましくは1~30 重量部、より好ましくは3~20重量部程度添加するこ 50 上に、有機発光層(3)及び陰極(4)が順次積層され

とが望ましい。酸化防止剤と前記可塑剤とを併用する場 合は、添加量の総量が1~120重量部、好ましくは5 ~100重量部、より好ましくは10~80重量部程度 添加することが望ましい。可塑剤や酸化防止剤の溶解度 が低い場合や融点が高い場合は、結晶析出を招いたり、 それ程接着性が向上しなかったりするため、可塑剤や酸 化防止剤の融点が100℃以下の化合物を用いることが 好ましい。

【0067】感光体を構成する支持体と下引層の間に連 鉄、ニッケル等の金属物を樹脂中に分散させたものや、 導電性の酸化スズ、酸化チタン、酸化アンチモン、酸化 ジルコニウム、ITO (インジウム、スズ酸化物固溶 体)等の金属酸化物を樹脂中に分散させたものが好適に 用いられる。

【0068】さらに、感光層上に表面保護層を設けても よい。表面保護層の膜厚は、5µm以下が望ましい。表 面保護層に用いられる材料としては、アクリル樹脂、ボ リアリール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ウレタン樹 20 脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂などのボリマーをその まま、または酸化スズ、酸化インジウムなどの低抵抗物 質を分散させたものなどが使用可能である。また、表面 保護層として、有機プラズマ重合膜を使用してもよい。 有機プラズマ重合際は必要に応じて適宜酸素、窒素、ハ ロゲン、周期律表の第3族、第5族原子を含んでもよ

【0069】なお 単層型の感光層を形成する場合は 電荷発光材料と電荷輸送材料とを、バインダ樹脂ととも に適当な樹脂に溶解した液を用いてディップコートやス

【0070】次に、一般式(I)で示される化合物を有 機エレクトロルミネッセンス素子の材料として用いた場 合について説明する。図1~図4に有機エレクトロルミ ネッセンス素子の実施形態を模式的に示した。図1中、 (1)は陽極であり、その上に、有機正孔注入輸送層 (2)と有機発光層(3). 及び陰極(4)が順次精層 された構成をとっており、該有機正孔注入輸送層には上 記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を含有する。 【0071】図2において、(1)は陽極であり、その 上に、有機正孔注入輸送層(2)と有機発光層(3)、 電子注入輸送層(5)及び陰極(4)が順次積層された 構成をとっており、該有機正孔注入輸送層または/およ び有機発光層に上記一般式(I)で表わされるアミノ化 合物を含有する。

【0072】図3において、(1)は陽極であり、その 上に、有機発光層(3)、有機電子注入輸送層(5)及 び陰極(4)が順次積層された構成をとっており、該有 機発光層に上記一般式(I)で表わされるアミノ化合物 を含有する。図4において、(1)は陽極であり、その た構成をとっており、該有機発光層に有機発光材料 (6)と電荷輸送材料(7)が含まれており、該電荷輸 送材料に上記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を 使用する。

【0073】上記構成の有機エレクトロルミネッセンス 素子は、陽極(1)と陰極(4)がリード線(8)によ り接続され、陽極(1)と陰極(4)に電圧を印加する ことにより有機発光層(3)が発光する。有機発光層、 正孔注入輸送層、電子注入輸送層には、必要があれば公 輸送材料を使用することもできる。

【0074】 一般式(I)で表わされる特定のアミノ化 合物は、イオン化ポテンシャルが小さく、正孔輸送能が 大きいため、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光 させるために必要な発光開始電圧は低くてよく、そのた め安定して長時間の発光を可能ならしめていると考えら れる。また、アミノ化合物を有機発光体として用いた場 合にはアミノ化合物自体の発光材料としての機能と熱安 定性が寄与しているものと考えられる。

(1)として使用される導電性物質としては4eVより も大きい仕事関数をもつものがよく、炭素、アルミニウ ム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、 タングステン、銀、金、白金、及びそれらの合金や、酸 化鍋、酸化インジウム、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸 化ジルコニウムなどの導電性金属化合物 さらにはポリ チオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用いら ns.

【0076】陰極(4)を形成する金属としては、4e Vよりも小さい仕事関数をもつものが好ましく、マグネ 30 ン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、 シウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウ ム、リチウム、ガトリニウム、イッテルビウム、ルテニ ウム、マンガン、及びそれらの合金が用いられる。陽極 及び陰極は、必要があれば二層以上の層構成により形成 されてもよい。

【0077】有機エレクトロルミネッセンス素子におい ては、発光が見られるように、少なくとも関極(1)あ るいは陰極(4)のいずれか一方は透明電極にする必要 がある。この際、陰極に透明電極を使用すると、透明性 が損なわれ易いので、陽極を透明電極にすることが好ま しい、透明電極を形成する場合、透明基板上に前述した ような導電性物質を用い、真空蒸着、スパッタリング等 手段や、ゾルーゲル法あるいは樹脂等に分散させて塗布 する等の手段を用いて所望の透光性と導電性が確保され るように形成すればよい。

【0078】透明基板としては、適度の強度を有し、有 機工レクトロルミネッセンス素子作製時、蒸着等による 熱による悪影響を受けず透明なものであれば特に限定さ れないが、係るものを例示すると、ガラス基板や透明な 樹脂、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ 50 ン、ペリノン、1,4-ジフェニルブタジエン、テトラ

ーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエ ステル等を使用することも可能である。ガラス基板上に 透明電極が形成されたものとしては、ITO、NESA 等の市販品が知られているが、これらを使用してもよ

【0079】有機エレクトロルミネッセンス素子の作製 例として、本発明のアミノ化合物を有機正孔注入輸送層 に用いた場合の構成(図1)を用いて説明する。まず、 上述した陽極(1)上に有機正孔注入輸送層(2)を形 知の発光材料、発光補助材料、キャリア輸送を行う電荷 10 成する。有機正孔注入輸送層は(2)は、前記した一般 式(1)で表わされるアミノ化合物を萎着して形成して もよいし、該アミノ化合物を溶解した溶液や、適当な樹 脂とともに溶解したディップコートやスピンコートとい った途布法により形成してもよい。

【0080】蒸着法で形成する場合、その膜厚は、通常 1~500m程度であり、途布法で形成する場合は5~ 1000nm程度に形成すればよい。形成する膜厚が厚い ほど発光させるための印加電圧を高くする必要があり、 発光効率が悪く。 有機エレクトロルミネッセンス素子の 【0075】有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極 20 劣化を招き易い。また、膜厚が薄くなると、発光効率は よくなるがブレイクダウンしやすくなり、素子の寿命が 短くなる。

【0081】一般式(I)の化合物は、他の電荷輸送材 料と併せて使用することができる。具体的には、フタロ シアニン化合物、ナフタロシアニン化合物、ポルフィリ ン化合物 オキサジアゾール トリアゾール イミダゾ ール、イミダゾリン、イミダゾールチオン、ピラゾリ ン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾ ール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾ ベンジジン型トリアリールアミン、ジアミン型トリアリ ールアミン等とそれらの誘導体、及びポリビニルカルバ ゾール、ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料等が 挙げられるが、その他にも、発光物質に対して優れた正 孔注入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入 層または電子輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成 能の優れた化合物等であれば使用できる。

【0082】上記有機正孔注入輸送層(2)上に、有機 発光層を形成する。有機発光層に用いられる有機発光材 40 料、発光補助材料としては、公知のものが使用可能で、 例えば、エピドリジン、2、5ービス(5、7ージーも ーペンチルー2ーベンゾオキサゾリル)チオフェン、 2. 2-(1, 4-フェニレンジビニレン) ビスペンゾ チアゾール、2、2-(4、4-ピフェニレン) ビスベ ンゾチアゾール、5-メチル-2-{2-[4-(5-メチルー2-ベンゾオキサゾリル)フェニル]ビニル ベンゾオキサゾール、2、5-ビス(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル)チオフェン、アントラセン、ナフ タレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレ

フェニルブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベ ン、2-(4-ビフェニル)-6-フェニルベンゾオキ サゾール、アルミニウムトリスオキシン、マグネシウム ビスオキシン、ビス (ベンゾー8-キノリノール) 亜 鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) アルミニ ウムオキサイド、インジウムトリスオキシン、アルミニ ウムトリス (5-メチルオキシン)、リチウムオキシ ン、ガリウムトリスオキシン、カルシウムビス (5-ク ロロオキシン)、ポリ亜鉛ービス(8-ヒドロキシ-5 ーキノリノリル)メタン、ジリチウムエピンドリジオ ン、亜鉛ビスオキシン、1,2-フタロベリノン、1, 2ーナフタロペリノン、トリス(8-ヒドロキシキノリ ン)アルミニウム錯体などを挙げることができる。

【0083】また、一般的な蛍光染料、例えばクマリン 染料、ベリレン染料、ピラン染料、チオピラン染料、ボ リメチン染料、メロシアニン染料、イミダゾール染料等 も使用できる。これらのうち、特に好ましい材料として は、キレート化オキシノイド化合物が挙げられる。有機 発光層は、前記した発光物質の単層構成でもよいし、発 してもよい。また、2種以上の発光物質を混合したり、 発光層にドープしてもよい。

【0084】有機発光層(3)は、上記のような発光物 質を萎着して形成してもよいし、該発光物質を溶解した 溶液や適当な樹脂とともに溶解した液を、ディップコー トやスピンコートといった途布法にて形成してもよい。 また 一般式(I) で表わされるアミノ化合物を発光物 質として用いてもよい。

【0085】蒸着法で形成する場合、その膜厚は、通常 O Onn程度に形成すればよい、形成する膜厚が厚いほど 発光させるための印加電圧を高くする必要があり、発光 効率が悪く、有機エレクトロルミネッセンス素子の劣化 を招き易い。また、膜厚が薄くなると、発光効率はよく なるがブレイクダウンしやすくなり、素子の寿命が短く なる.

【0086】次に、有機発光層(3)の上に、前記した 陰極(4)を形成して有機エレクトロルミネッセンス素 子とする。

【0087】図2に示したように、正孔注入輸送層 (2) 有機発光層(3) および電子注入輸送層

(5)を積層する場合、正孔注入輸送層と有機発光層の いずれか一方。または両者にアミノ化合物を用いること ができる。この場合、正孔注入輸送層はアミノ化合物を 用いてあるいはアミノ化合物を用いずに上述したのと同 様の手順で形成することができる。有機発光層も上述し たのと同様の手順で形成することができ、アミノ化合物 を発光物質として用いてもよい。アミノ化合物を発光物 質として使用する場合は、他の発光物質を混合したり有 機発光層にドープすることが好ましい。電子注入輸送層 50 ルーN,N'-(3-メチルフェニル)-1,1'-ビ

は、電子輸送材料を用いて、正孔注入輸送層や有機発光 層と同様に、蒸着法や塗布法等の従来公知の方法により 形成することができる。

【0088】電子輸送材料としては、例えば、フルオレ ノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、スチル ベンキノン、チオピランジオキシド、オキサジアゾー ル、ペリレンテトラカルボン酸、フルオレニリデンメタ ン、アントラキノン、アントロン等とそれらの誘導体が あるが、電子を輸送する能力をもち、発光層または発光 10 物質に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成 した励起子の正孔注入層または正孔輸送材料への移動を 防止し、かつ薄膜形成能の優れた化合物であればこれら に限定されるものではない。

【0089】図3に示したように、陽極(1)上に右機 発光層(3)と電子注入輸送層(5)とを積層する場 合、上述したのと同様の手順でアミノ化合物を用いて有 機発光層を形成することができる。また、上述したのと 同様にして電子注入輸送層を形成することができる。

【0090】また上記各構成において、正孔注入輸送層 光色、発光強度等の特性を調整するために、多層構成と 20 は、正孔注入機能と正孔輸送機能を分離して、正孔注入 層と正孔輸送層の2層構成としてもよい。この場合、正 孔注入層に一般式 (I) で表わされる本発明のアミノ化 合物を使用することが好ましい。

> 【0091】正孔輸送層としては公知の正孔輸送材を使 用することができ、例えば、N, N' -ジフェニル-N. N'-ビス (3-メチルフェニル)-1.1'-ジ フェニルー4, 4' -ジアミン、N, N' -ジフェニル -N. N'-ビス(4-メチルフェニル)-1.1'-ジフェニルー4、4'ージアミン、N、N'ージフェニ

1~500m程度、途布法で形成する場合は、5~10 30 ルーN, N'-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ジフ rニルー4. 4' -ジアミン. N. N' -ジフェニルー N. N'-ビス(2-ナフチル)-1.1'-ジフェニ ルー4,4'-ジアミン、N,N'-テトラ(4-メチ n = (n - 1, 1) - (n - 1)1'-ビス(3-メチルフェニル)-4.4'-ジアミ ン、N、N'ージフェニルーN、N'ービス(3ーメチ ルフェニル) - 1 . 1' - ビス (3 - メチルフェニル)-4, 4' -ジアミン、N, N' -ビス (N-カルバゾ 40 リル)-1,1'-ジフェニル-4,4'-ジアミン、

> 4.4'.4"-トリス(N-カルバゾリル)トリフェ ニルアミン、N、N'、N"ートリフェニルーN、 5ートリ(4ーアミノフェニル)ベンゼン、4、4'、 4"-トリス(N, N', N"-トリフェニル-N, N'. N"-トリス (3-メチルフェニル)] トリフェ ニルアミン、N、N'ージフェニルーN、N'ービス (4-メチルフェニル)-1,1'-ビス(3-メチル フェニル) -4, 4' -ジアミン、N, N' -ジフェニ

43 フェニルー4, 4'ージアミンなどを挙げることができ る。これらを2種以上混合して使用してもよい。

【0092】電子注入輸送層も、電子注入機能と電子輸 送機能を分離して、電子注入層と電子輸送層の2層構成 としてもよい。

【0093】図4に示したような単層構成の有機発光層 を形成するためには、有機発光材料と電荷輸送材料とを 共素着法により混合形成してもよいし、有機発光材料と 電荷輸送材料とを溶解した溶液や滴当を樹脂とともに溶 解した液を用いてディップコートやスピンコートするこ 10 これにテトラヒドロフラン100回を加えて溶解させ とにより形成してもよい。電荷輸送材料としては上述し た電子輸送材料または正孔輸送材料が用いられ、これら は混合して用いてもよいし、同じ輸送性の材料を2種以 上混合して用いてもよい。蒸着法で有機発光層を形成す る場合、その厚さは通常5~200nmであり、塗布法 で形成する場合、10~500nm程度に形成すればよ い。塗布法の場合、混合して使用する樹脂としては、ボ リビニルカルバゾールやボリビニルアセチレンのような 光導電性樹脂を用いると特に良好な特性を得ることがで きる。以上、陽極(1)上に各層を形成する場合を例に 20 とって説明したが、陰極(4)上に上述したのと同様の 手順で各層を形成しても構わない。

【0094】陰極と陽極とに二クロム線、金線、銅線、 白金線等の適当なリード線(8)を接続し、両電極に適 当な電圧(Vs)を印加することにより、有機エレクト ロルミネッセンス素子は発光する。本発明の有機エレク トロルミネッセンス素子は 各種の表示装置 あるいは ディスプレイ装置等に適用可能である。以下に実施例を 記載し、本発明を説明する。実施例中、「部」とある は、特に断らない限り、「重量部」を表わす。

【0095】合成例 (化合物(3)の合成) 水冷冷却管を設けた200mlの三つロフラスコに、テレ フタルアルデヒド6, 5g(0,05mol)と4'-ブロ モアセトフェノン40.0g(0,20mol)を入れ、こ れにトルエン25mlを加えて溶解させた。次に、三フッ 化ホウ素ージエチルエーテル錯体31、7ml(0,25 mol)をトルエン1 Omlに溶解し、この溶液を容温中機样 しながら加えた後、8時間、加熱環流させた。反応液を 室温まで冷却し、これに1、4-ジオキサン200回を ウム塩、34、0g(収率66%)を茶色結晶として得 t.

【化51】

分子式: Cse Hso Ne

【0099】電子写真感光体の電荷輸送材料への応用 実施例1



【0096】次に、1000mlの三つ口フラスコに、上 記ピリリウム塩16.0g(0.015mol)を入れ、 た。さらに、14%アンモニア水400㎡を加えた後、 50℃で1時間撹拌した。生成物をジクロロメタンで抽 出後、溶媒を減圧留去し、得られた結晶をジクロロメタ ン/ヘキサンの混合溶媒にて再結品処理し、下記のプロ モ化ピリジン誘導体、7.4g(収率58%)を赤茶色 結晶として得た。

【化52】

【0097】続いて、100mlの三つ口フラスコに、上 記プロモ化ビリジン誘導体3.4g(0.004mo 1)、p, p' -ジトリルアミン4.0g(0.020m ol)、ナトリウムセーブトキシド2.3g(0.024m ol)、酢酸パラジウムO、11g(O、0005mol)、

- 30 トリーtープチルホスフィン0.4g(0.0020mo 1)を入れ これに溶媒としてo-キシレン15mlを加え た後、窒素雰囲気下、120℃で3時間攪拌した、溶液 を容温まで冷却し、ジクロロメタン100mlを加えて内 容物を溶解させ、不溶物を沪別した後、残渣の溶媒を減 圧留去した。得られた反応混合物について、シリカゲル カラムクロマトグラフィー (展開溶媒:ヘキサン/トル エン=1/1 (vol/vol)) により精製し、目的化合物 (3) 2. 7g(収率52%)を淡黄色結晶として得
- 加えて析出した結晶をろ過、減圧乾燥し、下記のピリリ 40 【0098】得られた化合物の離点は199~201℃ であった。また、分子式の分析を行ったところ、以下の 結果を得た。なお、分子式の分析はCHN分析装置を用 いて行った。

計算值(%) C:87.50% H:6.12% N:6.38% 分析值(%) C:87.53% H:6.08% N:6.39%

> ※下記構造式で表わされるトリスアゾ化合物 【化53】

0.45部、ポリエステル樹脂(バイロン200;東洋 紡績社製)0.45部をシクロヘキサノン50部ととも にサンドミルにより分散させた。得られたトリスアゾ化 より、乾燥膜厚が0.3g/m2となる様に塗布した 後、これを乾燥させた。

【0100】このようにして得られた電荷発生層の上に アミノ化合物(1)50部及び、ボリカーボネート樹脂 (パンライトK-1300: 帝人化成社製) 50部を 4ジオキサン400部に溶解した溶液を、乾燥膜厚 が20 mmになるように塗布し、乾燥させて電荷輸送層 を形成した。このようにして、2層からなる感光層を有 する電子写直感光体が得られた。

【 0 1 0 1 】 こうして得られた感光体が市販の電子写真*20 【 化5 4 】

* 複写機 (ミノルタ社製; EP-540) を用い、-6K Vでコロナ帯電させ、初期表面電位Vo(V)、初期電 位を1/2にするために要した露光量E1/2(1ux・ 合物の分散物を80gのアルミドラム上に浸漬塗布法に 10 sec) 1秒間暗所中に放置したときの初期電位の減 衰率DDR1(%)を測定した。

【0102】実験例2~4

実施例1と同様の方法、同一の構成で、実施例1で用い たアミノ化合物(1)の代わりにアミノ化合物(3)。 (4)、(5)を用いた感光体が作製した。こうして得 られた感光体について、実施例1と同様の方法で、 Vo、E1/2、DDR1を測定した。

【0103】実施例5 下記構造式で表わされるビスアゾ化合物

0.45部 ポリスチレン樹脂(分子量40.000) 0.45部をシクロヘキサノン50部とともにサンドミ ルにより分散させた。得られたビスアゾ化合物の分散物 を80 ののアルミドラム上に浸漬塗布法により、乾燥膜 厚が0、3g/mとなる様に塗布した後、これを乾燥さ 30

【0104】このようにして得られた電荷発生層の上に アミノ化合物(9)50部及び、ポリアリレート樹脂 (U-100;ユニチカ社製)50部を1,4ジオキサ ン400部に溶解した溶液を、乾燥膜厚が25μmにな るように途布し、乾燥させて雷葡輸送層を形成した。こ のようにして、2層からなる感光層を有する電子写真感 光体が得られた。

【0105】実施例6~8

実施例5と同様の方法、同一の構成で、実施例5で用い 40 サン400部に溶解した溶液を乾燥膜厚が18μmにな たアミノ化合物(9)の代わりにアミノ化合物(1

- 1). (12). (13)を用いた感光体を作製した。 こうして得られた感光体について、実施例1と同様の方 法で、Vo、E1/2、DDR1を測定した。
- 【0106】実施例9
- 下記構造式で表わされる多環キノン系顔料 【化551



0.45部 ポリカーボネート樹脂 (パンライト-13 000: 帝人化成社製) 0.45部をジクロロエタン5 0部とともにサンドミルにより分散させ、得られた多環 キノン系顔料の分散物を800のアルミドラム上に、乾 燥膜厚がO.4g/m2となるように塗布した後、乾燥 させた。

【0107】このようにして得られた電荷発生層の上に アミノ化合物(17)60部、及びポリアリレート樹脂 (U-100:ユニチカ社製)50部を1、4-ジオキ るように塗布し、乾燥させて電荷輸送層を形成した。こ のようにして、2層からなる感光層を有する電子写真感 光体を作製した。

【0108】実施例10~11

実施例9と同様の方法で同一の構成のもの、但し実施例 9で用いたアミノ化合物(17)の代わりに、アミノ化 合物(18)、(19)を各々用いる感光体を作製し た。こうして得られた感光体について、実施例1と同様 の方法で、Vo、E1/2、DDR1を測定した。

50 【0109】実施例12

チタニルフタロシアニン0.45部、ブチラール樹脂 (BX-1: 積水化学工業社製) 0.45部をジクロロ エタン50部とともにサンドミルにより分散させ、得ら れたフタロシアニン顔料の分散物を80 4のアルミドラ ム上に、乾燥膜厚が0.3μmとなるように塗布した 後、乾燥させた。

【0110】このようにして得られた電荷発生層の上 に、アミノ化合物(23)50部、及びボリカーボネー ト樹脂(PC-Z: 三菱ガス化学社製) 50部を1,4 -ジオキサン400部に溶解した溶液を乾燥膜厚が18 10 して、単層型感光体を作製した。こうして得られた感光 μmになるように塗布し、乾燥させて電荷輸送層を形成 した。このようにして、2層からなる感光層を有する電 子写真感光体を作製した。こうして得られた感光体につ いて、実験例1と同様の方法で、Vo. E1/2、DDR1 を測定した。

【0111】実施例13

銅フタロシアニン50部とテトラニトロ銅フタロシアニ ン0. 2部を98%濃硫酸500部に充分撹拌しながら 溶解させ、これを水5000部にあけ、銅フタロシアニ ンとテトラニトロ釧フタロシアニンの光導電性材料組成 20 定結果を表1にまとめて示す。 物を析出させた後、ろ過、水洗し、減圧下120℃で乾 俊した.

*【0112】こうして得られた光導電性組成物10部を 熱硬化性アクリル樹脂 (アクリデュクA405:大日本 インク社製)22.5部、メラミン樹脂(スーパーベッ カミンJ820:大日本インク社製)7.5部、アミン 化合物(25)15部を、メチルエチルケトンとキシレ ンを同量混合した混合溶剤100部とともにボールミル ボットに入れて48時間分散して感光性塗液を調製し、 この塗液を80¢のアルミドラム上にスプレー塗布し、 乾燥して約15μmの感光層を形成させた。このように 体について、実験例1と同様の方法、但しコロナ帯電を +6KVで行いVo、E1/2、DDR1を測定した。 【0113】実施例14~15

実施例13と同様の方法で同一の構成のもの。但し実施 例13で用いたアミノ化合物(25)の代わりにアミノ 化合物(27)、(28)を各々用いる感光体を作製し た。こうして得られた感光体について、実施例13と同 様の方法で、Vo、E1/2、DDR1を測定した。実施例 1~15で得られた感光体のV₀、E_{1/2}、DDR₁の測 [0114]

	* 【表1】			
	V, (V)	E _{1/2} (Lux · sec)	DDR, (%)	
実施例1	-660	1. 0	2. 5	
実施例2	-660	1. 0	2. 8	
実施例3	-660	0. 9	2. 9	
実施例 4	-660	1. 0	3. 0	
実施例5	-650	0. 9	2. 7	
実施例6	-660	0. 9	3. 1	
実施例7	-670	0. 8	3. 0	
実施例8	-650	0. 7	2. 8	
実施例 9	660	1. 0	3. 3	
実施例10	-660	0. 9	2. 8	
実施例11	-650	0. 7	2. 8	
実施例12	-660	1. 0	3. 1	
実施例13	+670	0. 8	2. 8	
実施例14	+660	0. 9	3. 1	
実施例15	+650	0. 9	2. 8	

【0115】表1からわかるように、本実施例の感光体 は積層型でも単層型でも電荷保持能が充分あり、暗滅衰 率も感光体としては充分使用可能な程度に小さく。ま た、感度においても優れている。更に、市販の電子写真 複写機(ミノルタ社製; EP-350Z) による正帯電 時の繰り返し実写テストを実施例13の感光体において

- ※終画像において階調性が優れ、感度変化が無く、鮮明な 画像が得られた。このことから、本発明の感光体は繰り 返し特性も安定していることがわかる。
- 【0116】有機エレクトロルミネッセンス素子への応

実施例16

行ったが、1,000枚のコピーを行っても、初期と最※50 インジウム-スズ酸化物被覆ガラスの基板上に、有機正

孔注入輸送層としてアミノ化合物(3)を蒸着により厚 さ50mmの薄膜を形成した。次に、有機発光層として、 アルミニウムトリスオキシンを蒸着により50nmの厚さ になるように薄膜を形成した。更に、陰極として、マグ ネシウムを蒸着により200mの厚さになるように薄膜 を形成した。以上のようにして、有機エレクトロルミネ ッセンス素子を作製した。

【0117】実施例17~19

実施例16において、アミノ化合物(3)を使用する代 わりに、アミノ化合物(11)、(12)、(29)に 10 1,1'-ビフェニルー4,4'-ジアミンを真空蒸着 代えること以外は実施例16と全く同様にして、有機工 レクトロルミネッセンス素子を作製した。

【0118】実施例20

インジウムースズ酸化物被覆ガラスの基板上に有機正孔 注入輸送層としてアミノ化合物(30)を蒸着により7 Onnの厚さになるように薄膜を形成した。次に、有機発 光層として、アルミニウムトリスオキシンを100mmの 厚さになるように薄膜を形成した。次に、有機電子注入 輸送層として、下記のオキサジアゾール化合物:

【化56】

を塞着により50nmの厚さになるように薄膜を形成し た、更に、降極として、マグネシウムを萎着により20 Onnの厚さになるように薄膜を形成した。以上のように して 有機エレクトロルミネッセンス素子を作製した。 【0119】実施例21~23

実飾例20に於いて、アミノ化合物(30)を使用する 代わりに、アミノ化合物(37)、(39)、(40) を使用すること以外は実施例20と全く同様にして有機 30 更に、陰極として10:1の原子比でMg及びAgを蒸 エレクトロルミネッセンス素子を作製した。

【0120】実施例24

インジウムースズ酸化物被覆ガラスの基板上に、有機発 光層としてアミノ化合物(29)を蒸着により50mの 厚さで薄膜を形成した。次に、有機電子注入輸送層とし てオキサジアゾール化合物:

【化57】

を蒸着により20mの厚さになるように薄膜を形成し た、更に、陰極として10:1の原子比でMg及びAg を茎着により20nmの厚さになるように薄膜を形成し た。以上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス 素子を作製した。

【0121】実施例25

インジウムースズ酸化物器ガラスの基板上に、アミノ化 合物(42)を真空業着して膜厚20mmの正孔注入層を 形成した。次に、N, N' - ジフェニル-N, N' -(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4, 4' -ジアミンを真空蒸着して、膜厚4 Onmの正孔輸送 50 入輸送層として下記アミノ化合物;

層を形成した。次に、トリス(8-ヒドロキシキノリ ン) アルミニウム錯体を蒸着により50nmの厚さになる ように薄膜を形成した。更に、陰極として10:1の原 子比でMg及びAgを蒸着により200mの厚さになる ように薄膜を形成した。以上のようにして、有機エレク トロルミネッセンス素子を作製した。

【0122】実施例26

インジウム-スズ酸化物被覆ガラス基板上に、N,N' -ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-して、膜厚60nmの正孔注入輸送層を形成した。次に、 トリス (8-ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯体と アミノ化合物(44)を3:1の割合で直空蒸着により 6 Onmの厚さになるように発光層を形成した。更に、陰 極として10:1の原子比でMg及びAgを蒸着により 200mの厚さになるように薄膜を形成した。以上のよ うにして、有機エレクトロルミネッセンス素子を作製し t>.

【0123】実験例27

20 インジウム-スズ酸化物被覆ガラスの基板上にアミノ化 合物(45)をジクロロメタンに溶解させ、スピンコー ティングにより膜厚5 Onmの正孔注入輸送層を得た。更 に、トリス (8-ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯 体を萎着により20mの厚さになるように発光層を形成 した後、下記オキサジアゾール化合物; 【化58】

t-Bu-(>-t-Bu

を蒸着により膜厚20mの電子注入輸送層を形成した。 着により200mの厚さになるように薄膜を形成した。 以上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス素子 を作製した。

【0124】実施例28~30

実施例27に於いて、アミノ化合物(45)を使用する 代わりに、アミノ化合物(46)、(48)、(49) を使用すること以外は実験例27と全く同様にして、有 機工レクトロルミネッセンス素子を作製した。インジウ ムースズ酸化物被覆ガラスの基板上に、アミノ化合物 (52)、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニ ウム錯体、ポリメチルメタクリレートを3:2:5の重 量比率でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーテ ィング法により膜厚100nmの発光層を形成した。次 に、陰極として10:1の原子比でMg及びAgを蒸着 により200mの厚さになるように薄膜を形成した。以 上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス素子を 作製した。

【0125】比較例1

インジウムースズ酸化物被覆ガラス基板上に有機正孔注

を真空蒸着により、厚さ50mの薄膜を形成した。次 に、有機発光層として、アルミニウムトリスオキシンを 真空蒸着により厚さ50nmになるように薄膜を形成し

た。以上のようにして、

*素子を作製した。 【0126】評価

実施例16~30及び、比較例1で得られた有機エレク トロルミネッセンス素子について、そのガラス電極を陽 極として直流電圧をかけた時の発光開始電圧、及び最高 発光輝度とその時の発光開始電圧を測定した。測定結果 を表2にまとめて示す。

[0127]

【表2】

	発光開始電圧	発光最高輝度	最高発光輝度に於	
	(V)	(cd√m²)	ける電圧 (V)	
実施例16	3. 6	16, 100	11. 9	
実施例17	3. 9	16, 000	12.0	
実施例18	3. 3	16, 200	11.8	
実施例19	3. 5	15, 800	11.9	
実施例20	3. 2	17, 000	12. 1	
実施例21	3. 7	18, 300	12.3	
実施例22	3. 1	16, 700	12. 2	
実施例23	3. 3	15, 900	12.0	
実施例24	3. 5	16, 600	11.9	
実施例25	3. 6	15, 900	12. 1	
実施例26	3. 2	17, 900	12. 0	
実施例27	3. 1	15, 800	11.7	
実施例28	3. 4	17, 600	12.4	
実施例29	3. 6	16, 900	12. 3	
実施例30	3. 1	16, 300	11.9	
比較例1	4. 5	8, 700	12. 1	

【0128】表2からわかるように、本発明の有機エレ クトロルミネッセンス素子は低電圧でも高い発光輝度を 示した。また、本発明の実験例16の有機エレクトロル ミネッセンス素子について、電流密度1mA/cm2で連 続発光させたところ、1,000時間以上安定な発光を 観測することができた。本発明の有機エレクトロルミネ 40 例の概略断面図 ッセンス素子は、発光効率、発光輝度の向上と素子の長 寿命化を達成するものであり、併せて使用される発光材 料、発光補助材料、電荷輸送材料、增感剤、樹脂、電極 材料等の素子構成材料、及び素子作製方法に限定される ものではない。 [0129]

【発明の効果】本発明は、優れた電荷輸送能力を有する 新規なアミノ化合物を提供する。該アミノ化合物を使用 することのより、感度、電荷輸送特性、初期表面電位、 暗減衰率等の初期電子写真特性に優れ、繰り返し使用に※50 3:有機発光層

※対する疲労も少ない電子写真感光体、及び発光強度が大 さく発光開始電圧が低い。 耐久性に優れた有機エレクト ロルミネッセンス素子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】 【図1】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成

【図2】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成

例の概略断面図 【図3】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成

例の概略断面図 【図4】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成 例の概略断面図

【符号の説明】

1:陽極

2:正孔注入輸送層

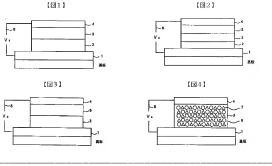
4:陰極

53

6:有機発光材料

5:電子注入輸送層

7:電荷輸送材料 8:リード線



フロン	トペー	ジの縛さ

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	Ť-₹3- ト ′ (参考
C 0 7 D 401/14	209	C O 7 D 401/14	209 40204
413/14	213	413/14	213 4H006
417/14	213	417/14	213
C 0 9 K 11/06	620	CO9K 11/06	620
	645		6 4 5
	655		655
G 0 3 G 5/06	312	G03G 5/06	312
H 0 5 B 33/14		H O 5 B 33/14	A
33/22		33/22	D

(72)発明者 古川 慶一

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタ株式会社内

F ターム(参考) 2H068 AA20 BA12 BA16 EA04 GA18 3K007 AB02 AB03 AB06 AB11 CA01

> CB01 DA01 DB03 EB00 40036 AA02 AA14 AA17

40055 AA01 BA03 BA08 BA27 BB04 CA01 DA08 DA27 DB04 DB10

EA01 40063 AA05 BB06 CC12 CC54 CC64

DD08 DD12 EE10

4C204 BB05 CB03 DB01 EB01 FB16

4H006 AA01 AA02 AB92 AC28 AC52 BJ50 BU46 FC52